

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成26年8月28日(2014.8.28)

【公表番号】特表2013-534706(P2013-534706A)

【公表日】平成25年9月5日(2013.9.5)

【年通号数】公開・登録公報2013-048

【出願番号】特願2013-519198(P2013-519198)

【国際特許分類】

H 05 B 33/10 (2006.01)

H 05 B 33/04 (2006.01)

H 01 L 51/50 (2006.01)

H 05 B 33/06 (2006.01)

【F I】

H 05 B 33/10

H 05 B 33/04

H 05 B 33/14 A

H 05 B 33/06

【手続補正書】

【提出日】平成26年7月9日(2014.7.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

OLEDデバイスを製造する方法であって、

複数の導電性ストリップを基板上に与えるステップと、

当該基板上の前記導電性ストリップによって仕切られた領域内に有機層を配置するステップと、

前記OLEDデバイスを封止するために、封止剤を前記導電性ストリップ上へ与えるステップと、

各導電性ストリップ上へ少なくとも部分的に導電性の保護層を、前記封止剤の外にある導電性ストリップの表面が当該導電性の保護層によって保護されるように配置するステップと、

を含み、前記導電性の保護層を与えるステップが、転写層の一部又は一連の転写層をキャリアから転写するステップを含む、方法。

【請求項2】

前記キャリアがプラスチックの箔を有する、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記導電性ストリップ上へ前記導電性の保護層を配置するステップが、前記転写層の一部を前記キャリアから前記導電性ストリップ上に転写するためにレーザ転写を実行するステップを含む、請求項1に記載の方法。

【請求項4】

前記レーザ転写を実行するステップが、前記転写層が少なくとも部分的に前記導電性ストリップ上に転写されるよう、当該転写層の特定の場所にエネルギーを堆積させるステップを含む、請求項3に記載の方法。

【請求項5】

前記転写層が前記有機層と直接接觸するよう、前記キャリアが前記有機層に対して配置される、請求項1乃至4の何れか一項に記載の方法。

【請求項6】

前記導電性の保護層を前記導電性ストリップ上へ与えるステップが、前記OLEDデバイスを封止するステップに先行する、請求項1乃至4の何れか一項に記載の方法。

【請求項7】

OLEDデバイスであって、

基板上へ与えられた複数の導電性ストリップと、

前記基板上の前記導電性ストリップに仕切られた領域の中に配置された有機層と、

前記導電性ストリップとの間に電気的な接觸が構築されるように、当該導電性ストリップに当接するよう配置された導電性の保護層と、

前記OLEDデバイスを封止するための封止剤であって、前記導電性ストリップの表面が前記導電性の保護層により保護されるよう、前記導電性の保護層と前記導電性ストリップとの境界に与えられた封止剤と、

を有する、OLEDデバイス。

【請求項8】

前記導電性の保護層が少なくとも一つの耐腐食性金属を有する、請求項7に記載のOLEDデバイス。

【請求項9】

前記導電性の保護層が厚くても $1.0\text{ }\mu\text{m}$ 、より好ましくは $0.3\text{ }\mu\text{m}$ 、最も好ましくは 100 nm の厚さを有する、請求項7に記載のOLEDデバイス。